

Decaborane 과 Ammonia로 부터 질화붕소(BN) 미분체의 합성

손영국 · 이윤복 · 박홍체 · 오기동

부산대학교 무기재료공학과

(1989년 2월 20일 접수)

Preparation of Fine Boron Nitride Powders from Decaborane and Ammonia

Young Gook Son, Yoon Bok Lee, Hong Chae Park and Ki Dong Oh

Dept. of Inorganic Materials Engineering, Pusan National University

(Received February 20, 1989)

요약

Decaborane과 ammonia로 부터 ammonia-decaborane 유도체를 만들고 이것을 출발원료로 하여 암모니아와 알곤 기류하에서 300~1450°C까지의 온도범위에서 질화붕소 미분체의 합성을 시도하고 그 생성조건 및 반응과정을 검토하였으며 합성 BN 분체의 특성을 IR, XRD, SEM 및 PSA 법을 이용하여 조사하였다.

BN은 800°C 이하의 질화반응에서는 BH, NH의 결합이 우세하지만 800°C 이상에서는 BH 및 NH의 결합이 소멸하여 육방정의 질화붕소가 생성되었다. 1500°C에서 합성된 BN 분말의 crystallite의 크기는 $L_a=470\text{ \AA}$, $L_c=180\text{ \AA}$ 이고 격자상수는 $a=2.5062\pm1\text{ \AA}$, $c=6.8285\pm2\text{ \AA}$ 이었다. 또한 입자크기분포는 2.0~5.4 μm이었다.

ABSTRACT

The preparation of the fine BN powders by ammonia-nitridation of ammonia-decaborane derivate was attempted at temperature between 300 to 1500°C. The formation mechanism of BN was examined and the resultant BN powder was characterized by means of IR, XRD, SEM and PSA method.

In the nitridation below 800°C bonding materials were identified with mainly BH and NH but above 800°C with BN by IR spectra and X-ray patterns. Crystallite size, lattice constant and particle size distribution of hexagonal BN prepared at 1,500°C were $L_a=470\text{ \AA}$, $L_c=180\text{ \AA}$, $a=2.5062\pm1\text{ \AA}$, $c=6.8285\pm2\text{ \AA}$ and 2.0~5.4 μm, respectively.

1. 서 론

최근 고경도 및 내침식재료가 새로운 기계구조 및 기계결 cấu구재료로서 각광을 받고 있다. 질화붕소(BN)는 고

융점(3000°C), 고경도(다이아몬드 다음으로 강한 Borazon)¹⁾을 갖고 화학적으로 내침식성이 우수하여 유망한 초경내열재료로써 주목을 끌고 있다. 붕소원료로서는 붕소산화물 및 붕소 할로겐화물을, 환원제와 질소원료로서

는 암모니아, 요소 및 질소 등을 이용하여 합성하고 있다.^{2,3)} 소망하는 질화붕소 소결체를 얻으려면 출발원료의 순도를 제어할 필요가 있고 또한 질화붕소의 결정화과정도 그 출발원료나 합성법에 의존한다.⁴⁾ 저급 수소화붕소나 그 암모니아 부가체는 실온이나 대기중에서는 불안정하지만 붕소원자가 10개 이상으로 된 붕소화합물은 고상으로 비교적 안정하다⁵⁾는 것이 밝혀졌다.

본 연구에서는 Williams 법⁶⁾에 의해 decaborane($B_{10}H_{14}$)과 암모니아로 부터 ammonia-decaborane 유도체를 만들고 이것을 출발원료로 하여 암모니아와 질소기류 하에서 소정의 반응온도($300\sim1500^{\circ}\text{C}$), 반응시간(2~5시간)에서 질화붕소 미분체의 합성을 시도하고 가장 적합한 생성조건을 제시하였으며 질화반응과정 및 합성된 분말의 성질을 검토하였다.

2. 실험방법

2.1. 시료조제

승화하기 쉬운 decaborane($B_{10}H_{14}$)을 비승화성인 triammoniadecaborane($B_{10}H_{14}\cdot3\text{NH}_3$) 유도체로 변화시키기 위하여 decaborane($B_{10}H_{14}$, Sigma 사제) 2.44g을 벤젠(C_6H_6 , Junsei) 200 ml에 녹여 0.1 mol 농도의 용액을 만든 후 magnetic stirrer로 교반하면서 암모니아가스와 상온에서 반응시켰고, 이때 생성된 침전물을 벤젠으로 세척하면서 여과한 후 24시간 진공건조시켜 시료로 사용하였다. 암모니아기체는 KOH 및 soda lime으로 건조정제 하였으며 유속은 100 ml/min 이었다. 시료조제에 사용한 합성장치의 개략적 모형을 Fig.1에 나타내었다.

2.2. 질화반응

질화반응장치의 개략도를 Fig.2에 나타내었다. 약 1g의 시료를 BN boat에 넣고 이를 용융 알루미나 반응관(내경 30mm, 길이 540mm)의 중심에 놓이도록 하였다. 승온전에 반응관내로 암모니아가스를 충분히 흘려보내서 공기와 치화시킨 후 유량속도 100~150 ml/min 으로 유통시키면서 300~900°C 범위의 소정온도에서 2시간 반응시켰고 승온속도는 $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 이었다. 암모니아가스 중에서 실온까지 노광시킨 후 암모니아가스의 공급을 중단하였다. 가열로의 발열체는 탄화규소재질이며 노내의 온도는 Pt-Pt/Rh(13%) 열전대로 측정하였다.

2.3. 가열처리

시료를 Fig.2의 반응장치를 사용하여 상압가열처리하

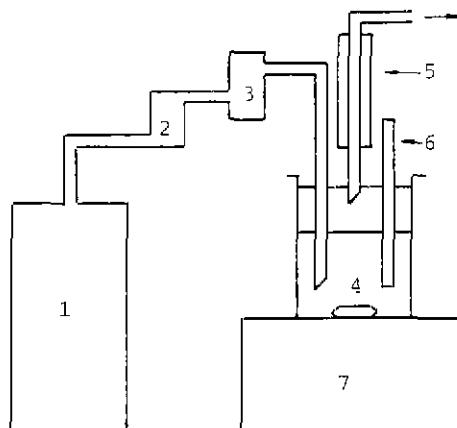


Fig.1. Schematic diagram of reaction apparatus for preparation of triammoniadecaborane from benzene and decaborane solution in ammonia gas stream.

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. cylinder (NH_3) | 2. flowmeter |
| 3. KOH tube | 4. reaction chamber |
| 5. condenser | 6. thermometer |
| 7. magnetic stirrer | |

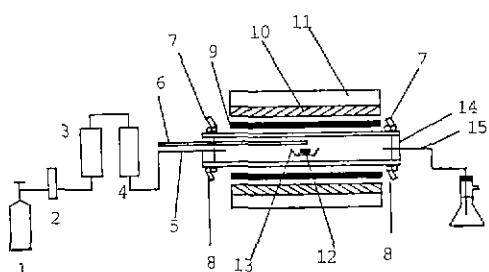


Fig.2. Schematic diagram of reaction apparatus for preparation of BN.

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. cylinder (NH_3) | 2. flowmeter |
| 3. KOH | 4. soda lime |
| 5. gas inlet | |
| 6. Pt-Pt / Rh(13%) thermocouple | |
| 7. cooling water inlet | |
| 8. cooling water outlet | |
| 9. SiC heating element | |
| 10. alumina brick | |
| 11. ceramic fiber insulator | |
| 12. sample | |
| 13. BN boat | |
| 14. silicon rubber | |
| 15. gas outlet | |

었다. 약 1g의 시료를 BN boat에 넣고 용융 알루미나 반응관의 중심에 놓이도록 한 후 유량속도 50~100 ml/

min의 아르곤기류 하에서 $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 의 승온속도로서
 $1300\sim1500^{\circ}\text{C}$ 의 온도까지 가열한 후 2시간 유지시켰다.
 가열처리한 시료는 아르곤기류하에서 상온까지 노광하였다.
 이때 아르곤 기체는 KOH 및 soda lime으로 전조시
 켰으며 활성화구리를 사용하여 산소를 제거하였다.

2.4. 분석방법

2.4.1. 적외선 흡수스펙트럼

생성물의 동정 및 질화반응 과정을 조사하기 위하여 시료 0.5 wt%와 KBr 99.5 wt%의 비로 혼합하여 disk 형상으로 성형하여 적외선 분광분석장치 (Hitachi 270~30)를 사용하여 400~4000 cm^{-1} 범위에서 측정하였다.

2.4.2. 부말 X 시회절

생성물의 동정 및 결정화 과정은 X 선회절장치(Rigaku 사제)를 사용하여 X 선 분말회절법으로 행하였다. 회절조건은 전압 40 kV, 전류 20 mA, Ni 필터와 graphite monochromater로 단색화한 CuK α 선을 이용하여 Sc 계수판으로 회절강도를 측정하였다. full scanning range는 800 cps, time constant는 1 sec, scanning speed는 8°/min, slit 계는 1°-0.6 mm-1°이었다.

BN의 crystallite 크기는 아래의 Scherrer 식을 이용하여 계산하였다.

여기서 t 는 crystallite의 두께(\AA), B 는 회절선의 반가폭(rad), θ 는 Bragg 각도, K 는 결정의 형상인자이다. 식 (1)에서 B 는 다음의 Warren 식으로 구하였다.

BN의 격자상수는 회절선의 회절각 $\sin\theta$ 를 측정하여 최소 2승법에 의하여 산출하였다. 회절선의 관측방정식은 아래와 같다.

여기서 hkl 은 회절면의 지수이고 xyz 는 결정의 역격자축을 실격자축으로 변환시킨 항이고, $E(\theta)$ 는 실험에 들어오는 계통오차를 θ 의 함수로 나타낸 것이고 θ 는 회절각 그리고 λ 는 입사선의 파장이다. 격자상수의 계산은 UNICS program⁷⁾을 이용하여 CYBER-180 쪼사기로 해야 한다.

2.4.3 일자크기부포

입도축정을 입자크기 분석장치(Seishin 사제)를 사용한

여 행하였다. 회전속도는 600 rpm 이고 분산매로는 에틸
알콜을 사용하였다.

2.4.4. 징자현미경 관찰

생성물의 입자모양 및 미세구조는 합성분말을 에틸릴콜 중에서 초음파로 분산시켜 주사형 전자현미경(국제과학기 기사 ALPHA-30 A)으로 가속진압 30 kV로 주사하여 관찰하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. Ammonia-Decahorane 유통체의 생성

반응이 진행함에 따라 투명한 용액이 옅은 연두색을 띠면서 침전물이 생성되기 시작하였다. 생성된 침전물은 시간이 경과함에 따라 옅은 노란색을 거쳐 백색으로 변하였는데 침전반응은 찬용개시 후 5-7분 사이에 종료되었 다.

출발원료인 decaborane과 칠전생성물의 직외선 흡수 스펙트럼을 Fig. 3에 나타내었다. 2500 cm^{-1} 부근의 강한 흡수 밴드는 B-H 결합의 stretching vibration, 3200 cm^{-1} 부근의 넓은 흡수 밴드는 N-H 결합의 stretching vibration에 기인한 것이다.³⁰ 또한 1400 cm^{-1} 의 흡수 밴드는 B-N 결합의 stretching vibration에 기인한 것이며 1000 cm^{-1} 이하의 일련의 흡수 밴드는 $-\text{NH}_3$ rocking vibration 및 B-H deformation vibration 등에 의한 것이다.³¹ 이상의 결과로 부터 decaborane과 암모니아로부터 얻어진 생성물은 triammoniadecaborane으로 생각된다.

3.2. 질화반응과정

Triammoniadecaborane 시료를 300°–900°C의 소정온

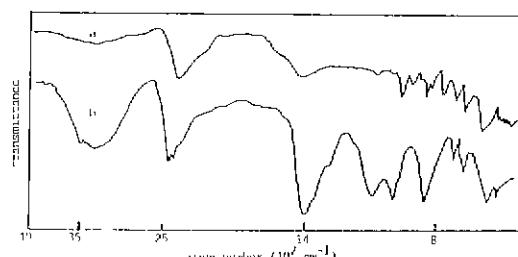


Fig.3. IR spectra of decaborane and product obtained from reaction

(a) decaborane (b) product obtained from reaction.

도에서 2~15시간 암모니아가스와 질화반응시켰다. Fig. 4에 질화반응에 의해 얻어진 반응생성물에 대한 적외선 흡수스펙트럼을 나타내었다. 300°C(Fig. 4 a)에서부터 400°C(Fig. 4 b)로 반응온도가 상승함에 따라 900 cm⁻¹에서 1300 cm⁻¹부근에 출현하였던 일련의 예리한 흡수밴드는 소멸되었다. 또한 triammoniadecaborane의 BN 신축진동에 의한 1400 cm⁻¹의 강하고 예리한 흡수밴드는 폭이 넓은 흡수밴드로 변하였다(Fig. 4 b). 이러한 변화는 triammoniadecaborane의 결합외에 BN 결합을 가진 비정질고체가 생성되었음을 알 수 있다. 500°C 반응생성물의 적외선 흡수스펙트럼(Fig. 4 c)은 800 cm⁻¹부근에 새로운 흡수밴드가 나타나기 시작하여 반응온도가 상승함에 따라 강해지는 것을 알 수 있는데 이것은 B₆N₃ 환상구조의 BNB결합에 기인한 것이다.¹⁰⁾ 한편 3200 cm⁻¹부근의 NH 및 2500 cm⁻¹부근의 BH 신축진동에 의한 흡수밴드의 경우 600°C에서의 생성물(Fig. 4 d)에는 약간 남아있었고 700°C에서의 생성물(Fig. 4 e)에서는 완전히 소멸되었다. 또한 NH 신축진동에 의한 3200 cm⁻¹부근의 흡수밴드는 반응온도가 상승함에 따라 소멸되었으나 3500 cm⁻¹부근의 흡수밴드는 반응과정에서 생성된 미량의 봉소산화물에 의한 것으로 추측된다.¹¹⁾ 800°C 2시간 반응에 의한 생성물의 적외선 흡수스펙트럼은 이미 알려진 열분해 질화봉소의 적외선 흡수스펙트럼¹²⁾과 잘 일치하고 있다.

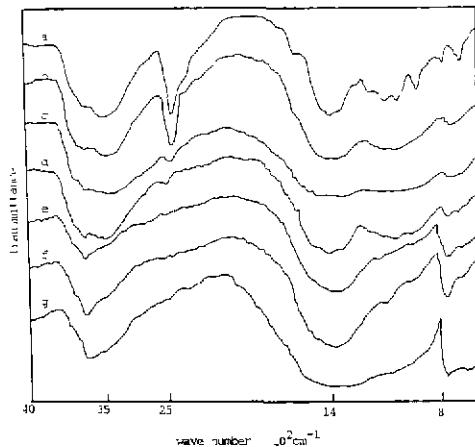


Fig. 4. IR spectra of reaction products from triammoniadecaborane and ammonia at various temperatures for 2 h.
 (a) 300°C, (b) 400°C, (c) 500°C, (d) 600°C,
 (e) 700°C, (f) 800°C, (g) 900°C

3.3. 생성물의 동정

Triammoniadecaborane과 암모니아가스의 500°C에서 800°C까지의 각 반응온도에서 얻은 생성물의 X선 회절도를 Fig. 5에 나타내었다.

500°C 2시간의 반응생성물(Fig. 5 f)은 회절각 25° 및 42°부근에 halo 모양의 회절선이 나타났으며 600° 및 700°C에서는 회절강도가 증가하였다. 또한 반응온도 800°C의 경우 2시간에서 10시간으로 반응시간이 증가함에 따라 회절강도가 증가하였다(Fig. 5 c, b, a). 회절각 25° 및 42°부근의 halo 모양의 회절선은 각각 육방정 질화봉소의 002 및 10의 회절선에 해당된다.¹³⁾ 이 결과로 부터 triammoniadecaborane과 암모니아가스가 800°C에서 반응하여 생성된 질화봉소는 결정도가 낮은 것으로 밝혀졌다.

적외선 흡수스펙트럼과 X선회절 결과로 부터 triammoniadecaborane과 암모니아가스의 반응은 다음과 같이 진행한다고 유추된다. 300°~400°C 까지의 온도에서 triammoniadecaborane은 암모니아와의 반응에 의해 결합이 철단되고 BN결합이 형성된다. 이 단계에서 봉

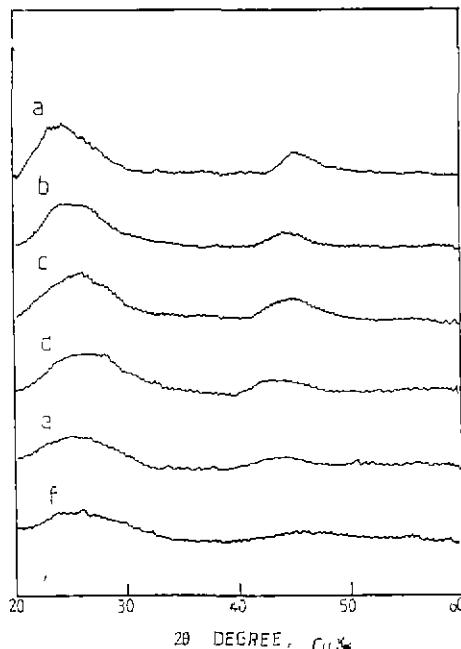


Fig. 5. XRD profiles of products synthesized from triammoniadecaborane and ammonia at temperatures between 500°C and 800°C.
 (a) 800°C, 10 h (b) 800°C, 5 h (c) 800°C, 2 h
 (d) 700°C, 2 h (e) 600°C, 2 h (f) 500°C, 2 h.

소와 질소의 비는 10 : 3에서 약 1 : 1에 도달할 때까지 질소가 보충되어지며 또한 탈수소반응이 동시에 시작된다고 생각된다. 500°C의 생성물은 NH 및 BH 결합이 대부분을 차지하고 BN 결합이 관여한 비정질고체이며, Fig. 4c의 적외선 흡수스펙트럼에 나타난 800 cm⁻¹부근의 흡수밴드의 존재는 B₃N₃ 육방정교체의 생성을 시사해 준다. 이러한 B₃N₃ 육방격자의 생성은 분밀 X 선회절도(Fig. 5f)에서도 확인되었다. 반응온도를 상승시킴에 따라 BH, NH 결합의 파괴에 의한 탈수소반응도 동시에 진행되어 700°C의 반응온도에서는 B₃N₃가 성장하여 X 선회절도(Fig. 5d)에서 회절강도의 증가가 관찰되었다. 800°C의 반응온도에서는 반응시간의 증가와 함께 B₃N₃ 육방정이 조금 더 성장하였다. 그러나 triammoniadecaborane과 암모니아를 800°C에서 10시간의 반응에 의해 생성된 백색고체도 결정도가 낮은 육방정의 B₃N₃질화붕소이었다.

다음은 triammoniadecaborane과 암모니아를 800°C에서 10시간 반응시켜서 생성된 질화붕소를 아르곤기류 중에서 상압하에 고온으로 재가열 처리하였다. 1300~1500°C까지의 각 온도에서 2시간 재가열처리하여 얻어진 생성물의 분밀 X 선회절도를 Fig. 6에 나타내었다. 1300°C에서 가열처리한 생성물(Fig. 6d)의 X 선회절도 상

에는 회절각 25° 및 42°부근에 halo 모양의 피크가 나타났으며 이것은 800°C의 반응생성물과 거의 유사하였다. 가열온도가 상승함에 따라 회절각 25°부근의 002회절선은 25.9°, 26.1°, 26.4°로 고각도측으로 이동하면서 예리해지는 경향을 보여주었으며 반기폭도 감소하고 있다. 또한 42°부근의 10회절선은 1350°C(Fig. 6c)에서 (100) 및 (101)면으로 분리되었고 회절각은 41.7°로서 거의 변화가 없었다. 또한 회절각 55°부근에 (004)면에 해당하는 회절선이 출현하여 온도가 상승함에 따라 회절강도가 증가하였다.

3.4. 격자상수 및 crystallite의 크기

분밀 X 선회절분석으로 부터 격자상수 및 crystallite의 크기를 계산하여 Fig. 7에 나타내었다.

합성한 질화붕소의 격자상수는 X 선회절도의 (002), (100), (004)면의 회절각 $\sin\theta$ 를 측정하여 최소 2승법으로 구하였다. 격자상수는 1350°C로 가열처리한 경우 $c=6.880 \text{ \AA}$ 이었고, 1400°C의 경우 $a=2.5063 \pm 1 \text{ \AA}$, $c=6.8593 \pm 3 \text{ \AA}$ 이며 가열온도의 상승에 따라 1500°C에서 $a=2.5062 \pm 1 \text{ \AA}$, $c=6.8285 \pm 2 \text{ \AA}$ 으로 되었다.

또한 crystallite의 크기는 (100)과 (002)면의 회절선을 이용하여 Scherrer 식과 Warren 식을 사용하여 계산하였다. 이때 Scherrer의 식에서 결정의 형상인자 K는 L_a 에 대해서는 1.84, L_c 에 대해서는 0.9를 각각 적용하였다.¹⁴⁾ crystallite의 크기 L_c 는 (002)면의 회절선으로 부터 산출

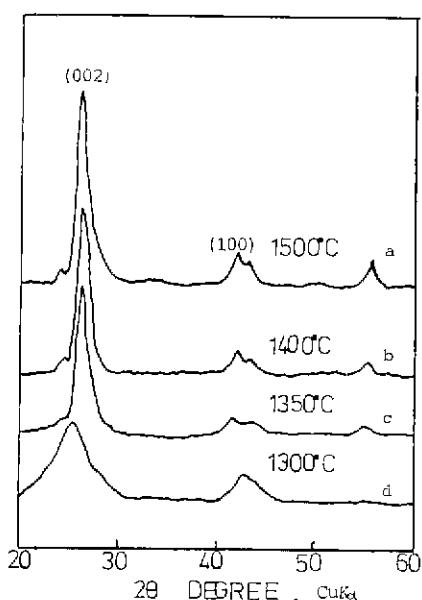


Fig. 6. XRD patterns of specimens treated at various temperatures under atmospheric pressure in Ar gas stream.

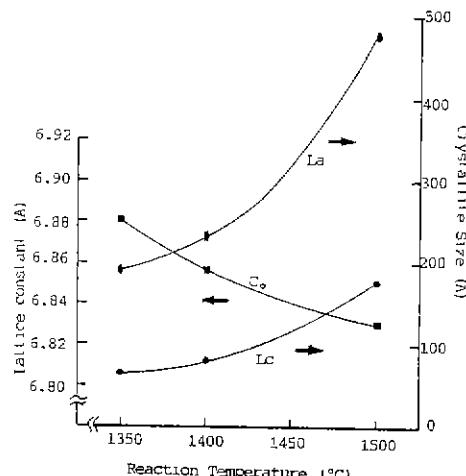


Fig. 7. Variations of lattice parameter C_0 , crystallite size L_a and L_c for samples treated at 1350°C, 1400°C, 1500°C for 2 h.

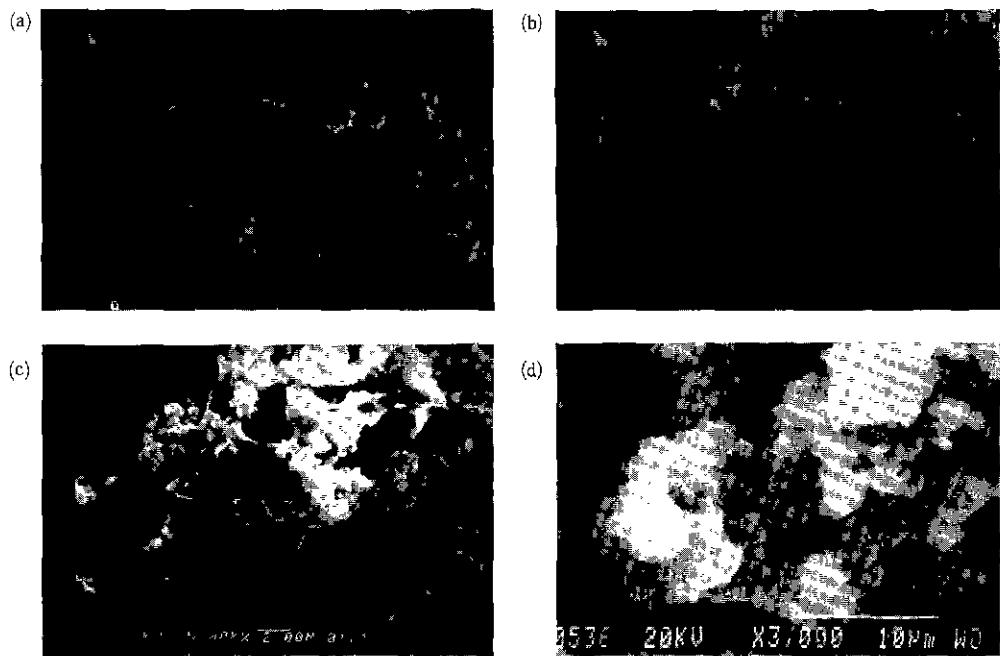


Fig.8. Scanning electron micrographs of

- (a) product reacted at 800°C for 2 h., (b) sample treated at 1100°C for 2 h.,
- (c) sample treated at 1300°C for 2 h., (d) smaple treated at 1400°C for 2 h..

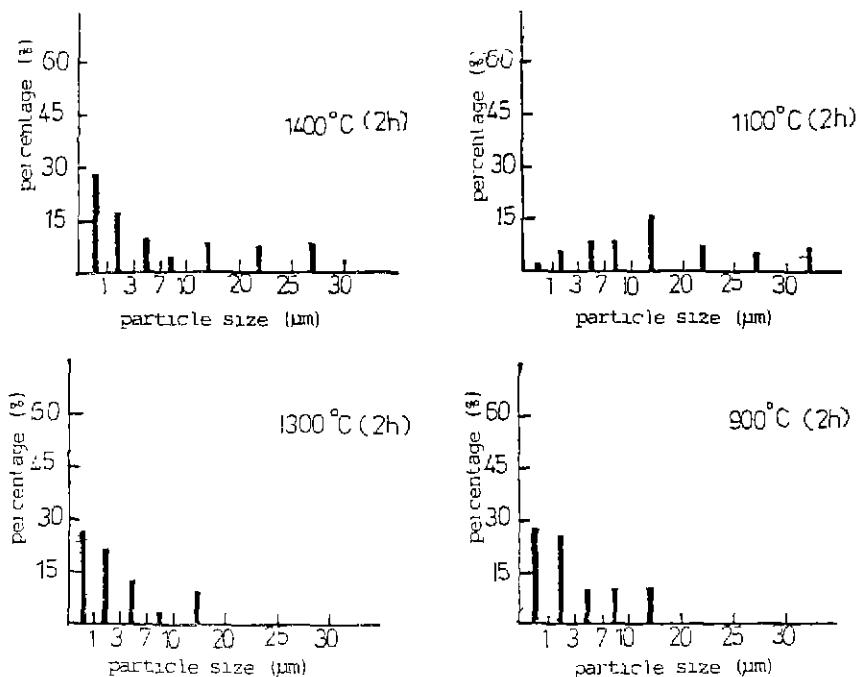


Fig.9. Particle size distribution of samples treated at various temperature.

하였는데 1350°C의 경우 60 Å, 1400°C, 1500°C에서는 각각 80 Å, 및 180 Å으로 증가하였고, 또한 (100)면으로부터 산출한 L_a 는 각각 190 Å, 230 Å 및 470 Å으로 증가하였다.

Triammoniadecaborane과 암모니아로 부터 합성된 질화붕소는 고온의 각 온도에서 재가열하여 일어진 생성물의 X선회절도와 적외선 흡수스펙트럼의 결과로 부터 결정화하기 어려운 난층구조의 질화붕소^[15]보다 저온에서 결정화가 진행될 수 있음을 알 수 있다. 따라서 본 연구에서 합성된 질화붕소에 험유된 B_3N_3 육방격자는 큰 층상구조로 성장하기 쉬운 배열을 하고 있다고 유추된다.

3.5. 생성물의 미세구조

출발물질 및 800°C 2시간의 반응생성물과 이를 고온의 각 온도에서 2시간 재가열 처리한 질화붕소 미분체에 대한 주사형 전자 현미경사진을 Fig.8에 나타내었다. 가열온도의 상승과 더불어 입자들의 응집현상과 입자성장이 일어났다. 1400°C에서 가열처리한 시료는 질화붕소 결정의 다수가 다각형의 판상구조를 보이고 있다.

각 온도에서 얻은 질화붕소의 입자크기 분포를 Fig.9에 나타내었다. 1300°C 이하의 비결정성 질화붕소(Fig.6 a)에 있어서는 온도의 상승과 더불어 미분체의 높은 반응성으로 인하여 1100°C까지는 전체적인 입자크기 분포가 증가하다가 1200°C를 지나면서 붕소산화물의 휘발등으로 인하여 입자의 대부분이 2 μm 이하 이었다. 1400°C에서는 입자성장과 부분적인 응집현상으로 말미암아 전체적인 입경분포가 다소 증가하여 평균입경이 5.4 μm로 나타났다.

4. 결 론

Decaborane을 암모니아와 반응시켜 triammoniadecaborane 유도체를 만들고 이 triammoniadecaborane과 암모니아와의 반응에 의해 고순도 질화붕소의 합성을 시도하고 질화붕소의 생성과정 및 특성을 검토하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

(1) Triammoniadecaborane을 800°C의 상압하에서 암모니아와 반응시켜서 얻은 질화붕소는 결정화가 낫았다.

(2) 암모니아는 300°C 부터 400°C 사이에서 triammoniadecaborane과 반응하여 붕소의 결합을 결단하고 BN 결합을 생성하였다. 이 반응생성물은 500°~800°C까지 탈수소반응에 의해 판상의 B_3N_3 육방정이 생성되었고, 800°C 이상에서는 탈수소반응이 종료하여 반응시간이 길

어짐에 따라 B_3N_3 층상구조가 생성되었다.

(3) 합성된 저 결정성의 질화붕소는 1500°C에서 2시간 가열처리한 격자상수 및 결정자크기는 각각 $a=2.5062 \pm 1\text{ \AA}$, $c=6.8285 \pm 2\text{ \AA}$ 및 $L_a=470\text{ \AA}$, $L_c=180\text{ \AA}$ 이었다. 또한 입자크기 분포는 부분적인 입자의 응집현상으로 평균입경이 약 5.4 μm 이었다.

REFERENCES

1. C.F.Gardiner, "Physical Properties of Superabrasives", *Ceram. Bull.*, 67(6), 1006 (1988).
2. T.E.O'Connor, "Synthesis of Boron Nitride", *J. Am. Chem. Soc.*, 84, 1753 (1962).
3. J.Kamlet, U.S Pat. 2865715 (1958).
4. H.Tagawa and K.Ishi-i, "The Formation and Crystalline Nature of Boron Nitride in the Reaction of Boron Trichloride with Ammonia", *J. Appl. Chem. Jpn.*, 70(5), 617 (1967).
5. J.C.Bailar, "Comprehensive Inorganic Chemistry", Vol.1, pp.665~849, Pergamon Press, Oxford & New York (1973).
6. J.Williams, R.L.Williams and J.C.Wright, "Boron Hydride Derivatives. Part IX, The Reaction of Decaborane with Ammonia", *J. Chem. Soc.*, 5816 (1963).
7. UNICS program, Crystallographic Society, Japan (1967).
8. G.F.Svatos, C.Curran and J.V.Quagliano, "Infrared Absorption Spectra of Inorganic Coordination Complexes. V: The N-H Stretching Vibration in Coordinatin Compounds", *J. Am. Chem. Soc.*, 77, 6159 (1955).
9. P.C.Li and M.P.Lepie, "Infrared Transmission of Pyrolytic Boron Nitride", *J. Am. Ceram. Soc.*, 48(5), 277, (1965).
10. R.Geick, C.H.Perry and G.Rupprecht, "Normal Modes in Hexagonal Boron Nitride", *Phys. Rev.*, 146(2), 543 (1966).
11. E.G.Brame, J.L.Margrave and V.W.Meloch, "Infrared Spectra of Inorganic Solids II -Oxides, Nitrides, Carbides and Borides", *J. Inorg. Nucl.*

- Chem., 5, 48 (1957).
12. F.A.Miller and C.H.Wilkins, "Infrared Spectra and Characteristic Frequencies of Inorganic Ions", Anal. Chem., 24, 1253 (1952).
13. R.S.Pease, "An X-ray Study of Boron Nitride", Acta Cryst., 5, 356 (1952).
14. J.Thomas, Jr , N.E.Weston and T.E.O'Connor, "Turbostratic Boron Nitride, Thermal Transformation to Ordered-layer-lattice, Boron Nitride", J. Am. Chem. Soc., 84(24), 4619 (1963).
15. H.Togawa and K.Ishi-i, "Crystallinity of Boron Nitride Fabricated in Various Ways", Bull. Chem. Soc. Japan, 35, 1425 (1962).

「후기」

본 연구는 한국과학재단의 1988년도 전반기 기초 연구 과제 지원비의 도움으로 수행되었습니다.